

都城工業高等専門学校	開講年度	令和04年度(2022年度)	授業科目	知的財産権概論				
科目基礎情報								
科目番号	0079	科目区分	一般 / 選択					
授業形態	授業	単位の種別と単位数	学修単位: 2					
開設学科	機械工学科	対象学年	5					
開設期	前期	週時間数	前期:2					
教科書/教材	TAC知的財産管理技法検定講座(2021)『知的財産管理技能検定(R)2級スピードテキスト21-21年度』早稻田経営出版 978-4-8471-4861-3							
担当教員	吉井 千周							
到達目標								
1 産業財産権法(特許法・実用新案法・意匠法・商標法)を理解することができる。								
2 特許情報を検索し、特許書類が読めるようになること。								
3 特許・実用新案・意匠明細書の書き方が理解できるようになること。								
ループリック								
	理想的な到達レベルの目安	標準的な到達レベルの目安	未到達レベルの目安					
産業財産権法の理解	産業財産権4法を基盤とした知的財産制度を理解し、知的財産に関連する時事の話題について自分で説明することができる。	産業財産権4法を基盤とした知的財産制度を理解し、知的財産に関連する時事の話題について説明を受けて理解することができる。	産業財産権4法を基盤とした知的財産制度を断片的に理解し、知的財産に関連する時事の話題を補助を受けながら理解することができる。					
特許情報の検索と先行特許調査	自分で特許情報を検索し、特許書類記事項の記載目的や意味を理解しながら読むことができる。	自分で特許情報を検索し、特許書類記事項の記載目的や意味を読み、その内容を把握することができる。	補助を受けながら、特許情報を検索し、特許書類記事項の記載目的や意味を理解できる。					
知的財産の活用と管理の理解	知的財産権の活用と管理を独力で行う事ができる。	知的財産権の活用と管理を補助を行って行う事ができる。	知的財産権の活用と管理を補助を行って行う事ができる。					
学科の到達目標項目との関係								
学習・教育到達度目標 C JABEE b JABEE d								
教育方法等								
概要	知的財産権法制のうち、特許法、実用新案法、意匠法、商標法からなる「工業所有権四法」を中心に理解する。また、特許権、意匠権、商標権取得のための手段・手続きについてその方法を学ぶ理解を深め『知的財産管理技能検定3級』程度の知財管理運用知識を身につける。							
授業の進め方・方法	「法学」で学習した法律の考え方、民法関連知識を復習すること。自主学習として、1 『知的財産管理技能検定3級』程度の問題演習を定期的に実施する。2 パテントコンテスト/エザインパテントコンテストへの応募を前提とした明細書及び発明関係書類執筆を義務づける。3 知的財産に関連した時事の話題に関心を持ち、自己学習を指示する。							
注意点	法学及び知的財産権制度に関する基礎的な知識を有しており、かつ、これに対する関心をもっていること。4年で開講されている「法学」を受講していない学生は、選択することができないので注意すること。							
ポートフォリオ								
授業の属性・履修上の区分								
<input checked="" type="checkbox"/> アクティブラーニング	<input checked="" type="checkbox"/> ICT 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 遠隔授業対応	<input checked="" type="checkbox"/> 実務経験のある教員による授業					
授業計画								
	週	授業内容	週ごとの到達目標					
前期	1stQ	1週 知的財産権とは	授業計画・達成目標・成績の評価方法等の説明 知的財産保護制度の必要性、権利の意義と種類、知的財産の性質、知的財産の歴史を理解する。					
		2週 新規性・進歩性	発明の定義、発明の対象、発明者、職務発明を理解する。					
		3週 特許出願・分割出願・出願変更、国内優先権	特許出願の手法と応用を理解する。					
		4週 拒絶理由通知への対応	特許査定への不服申し立てを理解する。					
		5週 特許侵害への対応	特許侵害への対応方法を理解する。					
		6週 実用新案法の制度と保護対象	実用新案法の概要を理解する。					
		7週 意匠法の目的と保護対象	意匠法の概要を理解する。					
		8週 前期中間試験 試験答案の返却及び解説	前期中間試験の実施 試験問題の解説及びポートフォリオの記入					
後期	2ndQ	9週 商標法の目的と商標の機能	商標法の概要を理解する。					
		10週 商標権の発生と存続期間	商標権の利用期間と継続方法について理解する。					
		11週 著作権法の目的と著作物	著作権法の概要を理解する。					
		12週 著作物の人格権	実用新案法によって守られる権利を理解する。					
		13週 不正競争防止法・独占禁止法・民法	不正競争防止法・独占禁止法・民法の知財に関する箇所についてその概要を理解する。					
		14週 条約	知的財産権関連条約の概要を理解する。					
		15週 知的財産権管理実務	これまでの授業を宮崎・都城の事例を元に実務面から振り返る。					
		16週 前期末試験 (1~7週目は試験答案の返却・解説及びポートフォリオの記入)	前期末試験・試験問題の解説及びポートフォリオの記入					
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標								
分類	分野	学習内容	学習内容の到達目標	到達レベル 授業週				

評価割合			
	定期試験	レポート	合計
総合評価割合	90	10	100
知識の基本的な理解	90	0	90
思考・推論・創造への適応力	0	10	10
汎用的技能	0	0	0
態度・志向性（人間力）	0	0	0
総合的な学習経験と創造的思考力	0	0	0